DIALOG(R) File 351:Derwent WPI
(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

009823133

WPI Acc No: 1994-102989/199413

XRAM Acc No: C94-047447 XRPX Acc No: N94-080413

Positive-working presensitised lithographic plate contg. phenol deriv. - eliminates ink spread due to burning treatment and has wide development latitude and good ink receptivity

Patent Assignee: FUJI PHOTO FILM CO LTD (FUJF)
Inventor: KAWAUCHI I; MIZUTANI K; NAGASHIMA A
Number of Countries: 003 Number of Patents: 005

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	App	plicat No	Kind	Date	Week	
EP 589309	A1	19940330	EP	93114594	A	19930910	199413	В
JP 6282067	A	19941007	JP	92245049	A	19920914	199445	
EP 589309	B1	19980121	ΕP	93114594	A	19930910	199808	
DE 69316495	E	19980226	DE	616495	A	19930910	199814	
			EP	93114594	A	19930910		
JP 2944327	B2	19990906	JP	92245049	A	19920914	199942	

Priority Applications (No Type Date): JP 92245049 A 19920914 Cited Patents: Jnl.Ref; EP 424124; EP 460416; EP 477691; EP 541112 Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP 589309 A1 E 40 G03F-007/004

Designated States (Regional): DE NL

JP 6282067 A 22 G03F-007/00

EP 589309 B1 E 59 G03F-007/004

Designated States (Regional): DE NL

DE 69316495 E G03F-007/004 Based on patent EP 589309

JP 2944327 B2 21 G03F-007/00 Previous Publ. patent JP 6282067

Abstract (Basic): EP 589309 A

A positive-working presensitised plate for use in making a lithographic printing plate comprises a substrate bearing a light sensitive layer comprising a positive working light sensitive compsn. contg. a phenol deriv., a water-insol. and alkaline water-sol. resin, and an o-quinonediazide or a diazonium salt or a mixt. of a cpd. capable of forming an acid on exposure to light with a cpd. having at least one C-O-C gp. capable of being decomposed by the acid, the phenol deriv. having 4-8 benzene nuclei, at least one phenolic hydroxyl gp. and at least two gps. of formula -CH2OR' (I): R' is H, alkyl or acyl.

Also claimed is a method of producing a lithographic printing plate comprising imagewise exposure of a plate as claimed followed by development and a burning treatment.

Pref. R' is 1-4C alkyl or formyl, acetyl, butyryl, benzoyl, cinnamoyl or valeryl. The number of gps. of formula (I) is pref. 2-16.

USE/ADVANTAGE - This invention provides a positive working plate which does not suffer from contamination (spread of ink receptive elements into non-image areas during burning heat treatment of the developer plate) even after high-temp. burning. The plate has good development latitude and good ink receptivity.

Dwg.0/0

Abstract (Equivalent): EP 589309 B

A positive-working presensitised plate for use in making a lithographic printing plate comprises a substrate bearing a light sensitive layer comprising a positive working light sensitive compsn. contg. a phenol deriv., a water-insol. and alkaline water-sol. resin, and an o-quinonediazide or a diazonium salt or a mixt. of a cpd.

capable of forming an acid on exposure to light with a cpd. having at least one C-O-C gp. capable of being decomposed by the acid, the phenol deriv. having 4-8 benzene nuclei, at least one phenolic hydroxyl gp. and at least two gps. of formula -CH2OR' (I): R' is H, alkyl or acyl.

Also claimed is a method of producing a lithographic printing plate comprising imagewise exposure of a plate as claimed followed by development and a burning treatment.

Pref. R' is 1-4C alkyl or formyl, acetyl, butyryl, benzoyl, cinnamoyl or valeryl. The number of gps. of formula (I) is pref. 2-16.

USE/ADVANTAGE - This invention provides a positive working plate which does not suffer from contamination (spread of ink receptive elements into non-image areas during burning heat treatment of the developer plate) even after high-temp. burning. The plate has good development latitude and good ink receptivity.

which does not suffer from contamination (spread of ink receptive elements into non-image areas during burning heat treatment of the developer plate) even after high-temp. burning. The plate has good development latitude and good ink receptivity.

Dwg.0/0

Title Terms: POSITIVE; WORK; PRESENSITISED; LITHO; PLATE; CONTAIN; PHENOL; DERIVATIVE; ELIMINATE; INK; SPREAD; BURN; TREAT; WIDE; DEVELOP; LATITUDE; INK; RECEPTIVE

Derwent Class: A89; E14; G07; P84

International Patent Class (Main): G03F-007/00; G03F-007/004

International Patent Class (Additional): G03F-007/016; G03F-007/022; G03F-007/023; G03F-007/039

File Segment: CPI; EngPI

Manual Codes (CPI/A-N): A08-M08; A10-E05; A10-E10; A12-L02B1; A12-W07B; E10-A09B1; G05-A01; G06-D05; G06-F03C; G06-F03D; G06-G17; G06-G18 Chemical Fragment Codes (M3):

- *01* C017 C316 F011 F014 F423 F433 F553 F653 G001 G002 G010 G011 G012 G013 G014 G015 G016 G017 G018 G019 G020 G021 G022 G023 G029 G040 G100 G111 G112 G113 G221 G299 H100 H102 H103 H141 H142 H181 H201 H202 H211 H321 H341 H342 H343 H401 H441 H541 H542 H543 H594 H600 H608 H609 H641 H642 H643 H8 J011 J331 J371 J581 J582 J583 K0 K122 K130 K432 K5 K533 K599 K610 K850 L110 L143 L199 L7 L722 L724 M111 M112 M119 M121 M122 M124 M129 M131 M132 M136 M139 M141 M142 M143 M147 M149 M150 M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M240 M262 M272 M273 M280 M281 M282 M283 M311 M313 M320 M321 M331 M340 M342 M413 M414 M510 M520 M521 M531 M532 M533 M540 M640 M782 M903 M904 Q344 Q349 R043 9413-A9701-M
- *02* G013 G015 G016 G017 G019 G035 G038 G039 G100 G113 G563 H4 H403 H404 H405 H443 H444 H481 H482 H483 H484 H581 H582 H583 H584 H589 H8 J011 J012 J013 J014 J271 J272 J273 M1 M113 M121 M129 M132 M135 M139 M150 M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M262 M272 M280 M281 M282 M283 M311 M312 M313 M314 M315 M321 M322 M323 M331 M332 M340 M342 M343 M344 M373 M391 M392 M393 M414 M510 M520 M533 M540 M541 M782 M903 M904 Q349 R043 9413-A9702-M
- *03* G022 G023 G029 G037 G460 H4 H405 H444 H481 H482 H483 H484 H581 H582 H583 H584 H8 J011 J012 J013 J014 J271 J272 J273 M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M240 M262 M272 M281 M282 M283 M311 M321 M322 M323 M342 M373 M391 M392 M393 M414 M510 M520 M531 M540 M782 M903 M904 Q349 R043 9413-A9703-M 9413-A9703-M 06485

Polymer Indexing (PS):

<01>

- *001* 017; G1138 G1105 G1092 D01 D18 F31 F30 D11 D10 D19 D31 D50 D93; R00001 G1503 D01 D50 D81 F22; H0022 H0011; P0226 P0282-R; M9999 M2095-R; L9999 L2391; L9999 L2095-R
- *002* 017; G1116-R G1105 G1092 D01 D11 D10 D19 D18 D31 D50 D87 F31 F30; R00001 G1503 D01 D50 D81 F22; H0022 H0011; P0226 P0282-R; M9999 M2095-R; L9999 L2391; L9999 L2095-R
- *003* 017; ND01; Q9999 Q8684 Q8673 Q8606; Q9999 Q8800 Q8775; K9847-R

- K9790; N9999 N7147 N7034 N7023; K9552 K9483; B9999 B3521 B3510 B3372; B9999 B3463 B3452 B3372
- *004* 017; D01 D21 D18 D32 D53 D51 D59 D64 D90 F23 F61 N- 5A Cl 7A; D01 D61-R F16 N- 5A; R00516 G0760 G0022 D01 D24 D22 D32 D42 D51 D53 D59 D65 D88 F39 E00 E05; A999 A204; A999 A771
- *005* 017; D01 D11 D10 D19 D18 D23 D22 D32 D45 D50 D63 D69 D94 F19 F41 C1 7A; D01 D19 D18 D23 D22 D33 D45 D50 D69 D93 F19 F31 F30 F70 C1 7A; A999 A204; A999 A771
- *006* 017; D01 D11 D10 D12 D14 D13 D16 D19 D18 D20 D35 D34 D50 D51-R D53 D51 D54 D55 D57 D59 D63 D69 D95 F00 F23 F28 F26 F29 F31 F30 F32 F33 F34 F41 7A-R; A999 A748; A999 A771

<02>

- *001* 017; R00272 G1525 D01 D11 D10 D50 D83 F23; R00539 G1274 G1092 D01 D19 D18 D31 D50 D86 F33 F30; H0022 H0011; P0226 P0282-R; M9999 M2799; M9999 M2813; A999 A204; A999 A771; A999 A782
- *002* 017; S- 6A; H0157
- *003* 017; D01 D21 D18 D32 D53 D51 D59 D64 D90 F23 F61 N- 5A Cl 7A; H0226 Ring Index Numbers: 06485

Derwent Registry Numbers: 0272-U; 0516-U; 0539-U

Generic Compound Numbers: 9413-A9701-M; 9413-A9702-M; 9413-A9703-M

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平6-282067

(43)公開日 平成6年(1994)10月7日

(51) IntCl. ⁵		識別配号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G03F	7/00	503	7124-2H		
	7/022				
	7/023	511			

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 22 頁)

		街直明小 小明小 明小头小风工 〇〇 (工 60 人)
(21)出願番号	特顧平4-245049	(71)出願人 000005201 富士写真フイルム株式会社
(22)出願日	平成4年(1992)9月14日	神奈川県南足柄市中沼210番地
		(72)発明者 河内 幾生 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写 真フイルム株式会社内
		(72)発明者 永島 彰 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写 真フイルム株式会社内
		(72)発明者 水谷 一良 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写 真フイルム株式会社内
		(74)代理人 弁理士 中村 稔 (外6名)

(54)【発明の名称】 ポジ型感光性平版印刷版

(57)【要約】

【構成】 支持体上に感光層を設けてなるポジ型感光性 平版印刷版において、該感光層が、フェノール誘導体、水不溶かつアルカリ水可溶性樹脂及び、oーキノンジアジド又はジアゾニウム塩又は露光の際に酸を発生する化合物と酸によって分解可能な少なくとも1個のC-O-C基を有する化合物の混合物を含有するポジ型感光性組成物であって、該フェノール誘導体が、4~8個のベンゼン核、少なくとも1個のフェノール性ヒドロキシル基及び少なくとも2個の式(I)で表わされる基を有することを特徴とするポジ型感光性平版印刷版。

-CH₂ OR¹ (I)

(式中、 R^1 は水素原子、アルキル基又はアシル基を示す)

【効果】 高温でパーニング処理を行ってもパーニング 絡みを生じることがなく、現像許容性が広く、着肉性、 耐刷性が優れている。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体上に感光層を設けてなるポジ型感光性平版印刷版において、該感光層が、フェノール誘導体、水不溶かつアルカリ水可溶性樹脂及び、oーキノンジアジド又はジアゾニウム塩又は露光の際に酸を発生する化合物と酸によって分解可能な少なくとも1個のCーOーC基を有する化合物の混合物を含有するポジ型感光性組成物であって、該フェノール誘導体が、4~8個のペンゼン核、少なくとも1個のフェノール性ヒドロキシル基及び少なくとも2個の式(I)で表わされる基を有10することを特徴とするポジ型感光性平版印刷版。

$$-CH2 OR1$$
 (I)

(式中、R¹ は水素原子、アルキル基又はアシル基を示す)

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ポジ型感光性平版印刷版に関するものであり、詳しくは水不溶かつアルカリ水可溶性樹脂を含有する感光層を有するポジ型感光性平版印刷版に関するものである。

[0002]

【従来の技術】ポジ型感光性平版印刷版を露光し、現像 した後に、さらに加熱処理(以下、パーニング処理と称 する)することによって印刷版を製造する方法は、例え ば英国特許第1151199 号及び同第1154749 号に記載され ている。パーニング処理は通常、200~320℃で1 ~60分間加熱して行なわれる。この処理により画像部 は硬化し、耐刷力が著しく向上する。しかしながら、非 画像部、特にシャドー部においては、網点画像部から流 出したインキ受容性の有機物が非画像部に強固に付着す るため、印刷すると印刷汚れとなって現われる。この現 象を以後「パーニング絡み」と称する。パーニング絡み は一般にパーニング処理温度が高くなる程激しくなるこ とが知られている。この問題を解決するため、特公平1 -49932 号公報には、バーニング処理後の耐刷力を高め る添加物について記載されている。これにより、通常行 なっている200~320℃における処理と同程度の耐 刷力を、低温、例えば180℃程度の処理温度で得るこ とがてきると記載されている。しかしながら実際には、 180℃の処理でも、バーニング絡みは生じ、しかも通 40 常温度で処理するとパーニング絡みが激しく、上記問題 を本質的に改善しているものではない。しかも、親水性 添加物を多量に使用するため、他の印刷性能、例えば、 現像許容性、着肉性の大幅な低下を招くものである。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、高温 3個で、フェノール性ヒドロキシル基と式(I)で表わでパーニング処理を行っても、汚れ(パーニング絡み) される基を有する化合物は、パーニング絡みを低減するが生じないポジ型感光性平版印刷版を提供することである。さらに本発明の別の目的は、現像許容性が広く、着 め、本発明の感光性組成物はこれらの化合物を実質的に 肉性の良好なポジ型感光性平版印刷版を提供することで 50 含まないことが望ましい。より具体的には、感光性組成

ある。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者は上記目的を達成するため、鋭意検討を重ねた結果、本発明に至った。すなわち、本発明は、支持体上に感光層を設けてなるポジ型感光性平版印刷版において、該感光層が、フェノール誘導体、水不溶かつアルカリ水可溶性樹脂及び、ローキノンジアジド又はジアゾニウム塩又は露光の際に酸を発生する化合物と酸によって分解可能な少なくとも1個のC-O-C基を有する化合物の混合物を含有するポジ型感光性組成物であって、該フェノール誘導体が、4~8個のペンゼン核、少なくとも1個のフェノール性ヒドロキシル基及び少なくとも2個の式(I)で表わされる基を有することを特徴とするポジ型感光性平版印刷版である。

-CH₂ OR¹ (I)

(式中、R¹ は水素原子、アルキル基又はアシル基を示す)

【0005】以下、本発明を詳細に説明する。前記式 (I) のR1 において、アルキル基としては、メチル 基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-プチル基、イソプチル基、 sec-プチル基もしくは t-プチル基のような炭素数1~4のアルキル基が、アシル 基としては、ホルミル基、アセチル基、ブチリル基、ベ ンゾイル基、シンナモイル基、パレリル基が好ましい。 本発明に使用するフェノール誘導体は、公知のフェノー ル化合物、例えば、特開平1-289946号、特開平3-17 9353号、特開平3-200252号、特開平3-128959号、特 開平3-200254号、特顧平3-320438号、特顧平4-25 30 157 号に記載されているフェノール化合物と、ホルムア ルデヒドとを強アルカリ性媒体中で約0~80℃、好ま しくは10~60℃の温度で1~30時間反応させるこ とにより得られる。式 (1) で表わされる基の数は、反 応温度、反応時間により変えることができるが、2~1 6個のものが適当であり、好ましくは4~14個有する ことが好ましい。上記フェノール化合物の好ましい例と しては、後述の一般式 (II) ~ (IX) で示される化合物 であって、a、b、c、d、xおよびyがすべて0のも のを挙げることができる。本発明に使用するフェノール 誘導体の具体例としては、下記一般式 (II) ~ (IX) で 表わされる化合物があげられるがこれらに限定されるわ けではない。これらのフェノール誘導体は、単独で用い てもよく、二種以上混合して用いてもよいが、その際の 使用量は、感光性組成物中、0.2~60重量%、好まし くは0.5~20重量%である。また、ペンゼン核が1~ 3個で、フェノール性ヒドロキシル基と式(I)で表わ される基を有する化合物は、パーニング絡みを低減する 効果がない上に、着肉性、現像許容性の低下を招くた め、本発明の感光性組成物はこれらの化合物を実質的に

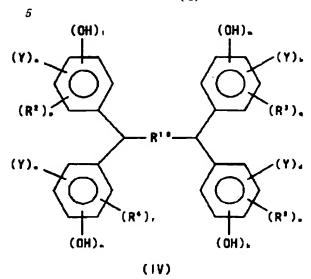
物に対して5 重量%以下であることが望ましく、更に好ましくは3 重量%以下であり、最も好ましくは0 重量%である。

【0006】 【化1】

(11)

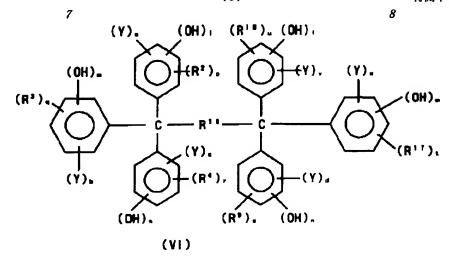
[0008] [化3]

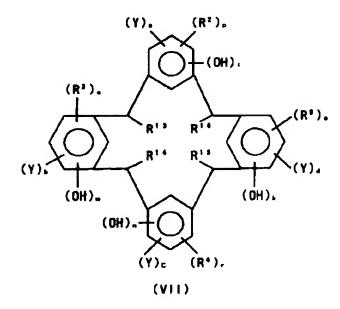
(111)



[0009]

【化4】





[0010] [化5]

[0011] 【化6】 (HO) (R^2) (Y)_b (HO)_ (CH₂), (CH:). (CH CH). (CH₂). (CH_z) (R4). (Y)2 (OH) k (HD),

【0012】式中、 $R^2 \sim R^4$ 、 R^9 、 R^{17} 、 R^{18} は水 素原子、ハロゲン原子、アルキル基又はアルコキシ基を 示し、 R^6 、 $R^{13} \sim R^{16}$ は水素原子又はアルキル基を示し、 R^6 $\sim R^8$ は水素原子、ハロゲン原子又はアルキル 基を示し、 $R^{10} \sim R^{12}$ は、単結合、 置換基を有してもよ 50

(IX)

いアルキレン基、アルケニレン基、フェニレン基、ナフチレン基、カルボニル基、エーテル基、チオエーテル基、アミド結合、又はそれら二種以上の結み合わせを示し、Yは一般式(I)で表わされる基を示し、a、b、c、d、x、yは、0~3の整数を示すが、a+b+c+d+x+yは2~16の整数であり、k、1、m、nは0~3の整数を示すが、すべてが0になることはな 30 く、e、f、g、h、p、q、r、s, t、uは0~3の整数を示し、zは0又は1を示す。前記一般式(II)~(IX)で表わされる化合物のより具体的な例としては、例えば下記構造のものがあげられる。

【0013】 【化7】

40

(XI)

[0015] 【化9】

10

20

30

(XII)

[0016]

【化10】

[0017]

【0018】 (式中、 $Y^1 \sim Y^{12}$ は、水素原子又は式 (I) で表わされる基を示すが、各化合物中、少なくと 62 個は式 (I) で表わされる基を有しており、好ましくは、すべてが式 (I) で表わされる基である。)

【0019】次に本発明のフェノール誘導体と組み合わせて使用するポジ型感光性組成物について説明する。ポジ型感光性組成物としては、従来より公知のローキノンジアジド化合物またはジアゾニウム塩を含む感光性組成物を使用することができる。これらの感光性組成物は主にローキノンジアジド化合物またはジアゾニウム塩とアルカリ可溶性パインダーからなるが、特にアルカリ可溶性パインダーがフェノール性樹脂である場合が好ましい。本発明に用いられるローキノンジアジド化合物は、少なくとも1個のローキノンジアジド基を有する化合物で、活性光線照射によりアルカリ可溶性を増すものであ

り、種々の構造の化合物を用いることができる。例えば、J. コーサー著「ライトーセンシティブ・システムズ」(John Wiley & Sons. Inc.)第339~352頁に記載の化合物が使用できるが、特に種々の芳香族ポリヒ40 ドロキシ化合物あるいは芳香族アミノ化合物と反応させた o ーキノンジアジドのスルホン酸エステルまたはスルホン酸アミドが好適である。また、特公昭43-28403号公報に記載されているようなベンゾキノン(1,2)-ジアジドスルホン酸クロライドとピロガロールーアセトン樹脂とのエステル、米国特許第3,046,120号および同第3,188,210号に記載されているベンゾキノン-(1,2)-ジアジドスルホン酸クロライドまたはナフトキノン-(1,2)-ジアジドスルホン酸クロライドまたはナフトキノン-(1,2)-ジアジドスルホン酸クロライドまたはナフトキノン-(1,2)-ジアジドスルホン酸クロライドまた

ルも好適に使用される。その他の有用なローキノンジア ジド化合物としては、数多くの特許に報告され知られて いる。例えば特開昭47-5303号、特開昭48-63802 号、 特開昭48-63803 号、特開昭48-96575号、特開昭49-3 8701 号、特開昭48-13354 号、特公昭41-11222 号、 特公昭45-9610号、特公昭49-17481 号、米国特許第2, 797, 213 号、同第3, 454, 400 号、同第3, 544, 323 号、同 第3,573,917 号、同第3,674,495 号、同第3,785,825 号、英国特許第1,227,602 号、同第1,251,345 号、同第 1,267,005 号、同第1,329,888 号、同第1,330,932 号、 ドイツ特許第854,890 号などの各明細書中に記載されて*

いるものをあげることができる。また本発明で使用され るジアゾニウム塩としては、米国特許第3,219,447 号、 同第3,211,553 号、特公昭39-7663号、特開昭52-2519 号、特願平3-325859号等に記載の公知のジアゾニウム 塩をあげることができる。特に効果的なジアゾニウム塩 の例としては下記一般式 (XVIII)、(XIX) 、(XX)、(XX 1) で示される化合物を挙げることができるが、これら に限定されるものではない。

20

[0020] 【化12】

$$\begin{array}{c}
R^{11} \\
N^{*} \equiv N \\
R^{21}
\end{array}$$
(XVIII)

$$(Z)_{*} = \begin{pmatrix} (OR^{11})_{*} \\ N^{*} \equiv N \\ (R^{11})_{*} \end{pmatrix}$$

$$Z = N \qquad N^{-} \qquad (XX)$$

$$(R^{18})_{*}$$

$$(R^{1}^{0})$$
, $N \equiv N^{+} \equiv N$ $2X^{-}$ (XXI)

【0021】式中R17は炭素数3~18のアルキル基ま たは置換アルキル基を示し、R18は水素原子、アルキル 基、置換アルキル基、アリール基、置換アリール基、ア ルコキシ基、置換アルコキシ基、フェノキシ基、置換フ ェノキシ基又はハロゲン原子を示す。X-は対アニオン を示す。 vは1~4の整数、wは1~3の整数を示し、 50 -NH-、-CH2 -、-CONH-又は-C(CH3)2 -を示す。

v+w=4である。R¹⁹、R²⁰は各々独立にアルキル 基、置換アルキル基、アリール基または置換アリール基 を示す。又R19とR20は互いに結合してモルホリノ基、 ピペリジノ基、ピペラジニル基、ピロリジニル基等の複 素環式基を形成しても良い。Wは酸素原子、硫黄原子、

2は水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリール 基、置換アリール基、アルコキシ基、置換アルコキシ 基、アルキルカルポニル基、置換アルキルカルポニル 基、アリールカルボニル基、置換アリールカルボニル 基、シアノ基、ニトロ基又はハロゲン原子を示す。 z は 1~5の整数を示す。Qは二価の連結基を示す。本発明 で使用されるローキノンジアジド化合物、またはジアゾ ニウム塩の添加量は好ましくは感光性組成物全固形分に 対し、1~50重量%、更に好ましくは5~30重量% の範囲である。これらの化合物は単一で使用できるが、 数種の混合物として使用してもよい。

【0022】また、酸によって分解することができる化 合物に基づいた材料を本発明の組成物に使用することも できる。この型の複写材料は公知であり、例えば米国特 許第3779778 号明細書及び同第4101323 号明細書、西ド イツ国特許第2718254 号明細書ならびに西ドイツ国特許 公開公報第2829512 号及び同第2829511 号中に記載され ている。この材料は、オルトカルボン酸誘導体、単量体 又は重合体アセタール、エノールエーテル又はアシルイ ミノカルポネートを酸によって分解することができる化 20 合物として含有する。この材料は、主に有機ハロゲン化 合物、殊にハロゲノメチル基によって置換されているs ートリアジンを、感光性でありかつ酸を発生する化合物 として含有する。米国特許第4101324 号明細書に記載の オルトカルポン酸誘導体の中で、脂肪族ジオールのピス -1, 3-ジオキサン-2-イルエーテルは、特に好ま しい。西ドイツ国特許第2718254 号明細書に記載のポリ アセタールの中で、脂肪族アルデヒド単位及びジオール 単位を有するものは、好ましく用いられる。更に、著し く好ましい混合物は、西ドイツ国特許公開公報第292863 6 号に記載されている。この場合、主鎮中に反復オルト -エステル基を有する重合体オルトエステルは、酸によ って分解することができる化合物として記載されてい る。この基は、5又は6員環を有する1、3-ジオキサ シクロアルカンの2-アルキルエーテルである。1、3 -ジオキサシクロヘキシ-2-イルアルキルエーテル単 位を有する重合体(この場合、アルキルエーテル基は、 エーテル酸素原子によって中断されていてもよく、好ま しくは隣接環の5位に結合している)は、特に好まし い。感光性組成物中で酸によって分解することができる 化合物の量は、一般に感光性組成物に対して8~65重 量%、好ましくは14~44重量%である。酸を発生す る化合物の量は、0.1~10重量%、好ましくは0.2~ 5重量%である。

【0023】次に、本発明に用いられる水不溶かつアル カリ水可溶性の樹脂としては、この性質を有する種々の 樹脂を使用することができるが、好ましい樹脂としては 下記ノボラック樹脂を挙げることができる。例えばフェ ノールホルムアルデヒド樹脂、m-クレゾールホルムア ルデヒド樹脂、p-クレゾールホルムアルデヒド樹脂、

o-クレゾールホルムアルデヒド樹脂、m-/p-混合 クレゾールホルムアルデヒド樹脂、フェノール/クレゾ ール (m-, p-, o-またはm-/p-, m-/o -, o-/p-混合のいずれでもよい) 混合ホルムアル デヒド樹脂などのクレゾールホルムアルデヒド樹脂など が挙げられる。その他レゾール型のフェノール樹脂類も 好適に用いられ、フェノール/クレゾール(m-, p -, o-またはm-/p-, m-/o-, o-/p-混 合のいずれでもよい) 混合ホルムアルデヒド樹脂が、好 10 ましく、特に特開昭61-217034号公報に記載されている フェノール樹脂類が好ましい。またフェノール変性キシ レン樹脂、ポリヒドロキシスチレン、ポリハロゲン化ヒ ドロキシスチレン、特開昭51-34711 号公報に開示され ているようなフェノール性水酸基を含有するアクリル系 樹脂、特開平2-866 号に記載のスルホンアミド基を有 するアクリル系樹脂や、ウレタン系の樹脂等、種々のア ルカリ可溶性の高分子化合物も用いることができる。こ れらのアルカリ可溶性高分子化合物は、重量平均分子量 が500~200,000で数平均分子量が200~6 0,000のものが好ましい。かかるアルカリ可溶性の 高分子化合物は1種類あるいは2種類以上を組み合わせ て使用してもよく、全感光性組成物固形分中、5~99 重量%、好ましくは10~90重量%の添加量で用いら れる。

【0024】本発明のポジ型感光性組成物には更に必要 に応じて、種々の添加剤を添加することができる。例え ばオクチルフェノールホルムアルデヒド樹脂の様な炭素 数3~8のアルキル基を置換基として有するフェノール とホルムアルデヒドの縮合物を併用することは、画像の 感脂性を向上させる上で好ましい。又更に感度を向上さ せる目的で、環状酸無水物類、フェノール類、有機酸類 を併用することもできる。環状酸無水物としては米国特 許第4,115,128 号明細書に記載されている無水フタル 酸、テトラヒドロ無水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタ ル酸、3,6-エンドオキシ-Δ'-テトラヒドロ無水 フタル酸、テトラクロル無水フタル酸、無水マレイン 酸、クロル無水マレイン酸、α-フェニル無水マレイン 酸、無水コハク酸、無水ピロメリット酸などが使用でき る。フェノール類としては、ピスフェノールA、p-ニ トロフェノール、p-エトキシフェノール、2, 4, 4'-トリヒドロキシペンゾフェノン、2,3,4-ト リヒドロキシベンゾフェノン、4-ヒドロキシベンゾフ エノン、4,4',4"-トリヒドロキシトリフェニル メタン、4,4',3",4"-テトラヒドロキシー 3, 5, 3', 5'ーテトラメチルトリフェニルメタン などが挙げられる。更に、有機酸類としては、特開昭60 -88942 号、特開平2-96755 号公報などに記載されて いる、スルホン酸類、スルフィン酸類、アルキル硫酸 類、ホスホン酸類、リン酸エステル類およびカルボン酸 50 類などがあり、具体的には、p-トルエンスルホン酸、

30

ドデシルベンゼンスルホン酸、p-トルエンスルフィン酸、エチル硫酸、フェニルホスホン酸、フェニルホスフィン酸、リン酸フェニル、リン酸ジフェニル、安息香酸、イソフタル酸、アジピン酸、p-トルイル酸、3,4-ジメトキシ安息香酸、フタル酸、テレフタル酸、1,4-シクロヘキセン-2,2-ジカルボン酸、エルカ酸、ラウリン酸、n-ウンデカン酸、アスコルピン酸などが挙げられる。上記の環状酸無水物、フェノール類および有機酸類の感光性組成物中に占める割合は、0.05~15重量%が好ましく、より好ましくは0.1~5重 10 量%である。

【0025】また、本発明における感光性組成物中に は、現像条件に対する処理の安定性を広げるため、特開 昭62-251740号公報や特開平3-208514号公報に記載さ れているような非イオン界面活性剤、特関昭59-121044 号公報、特開平4-13149 号公報に記載されているよう な両性界面活性剤を添加することができる。非イオン界 面活性剤の具体例としては、ソルピタントリステアレー ト、ソルピタンモノパルミテート、ソルピタントリオレ ート、ステアリン酸モノグリセリド、ポリオキシエチレ 20 ンノニルフェニルエーテル等が挙げられる。両面活性剤 の具体例としては、アルキルジ (アミノエチル) グリシ ン、アルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩、2-ア ルキルーN-カルポキシエチル-N-ヒドロキシエチル イミダゾリニウムペタインやN-テトラデシル-N, N -ベタイン型(例えば、商品名アモーゲンK、第一工業 (株) 製) 等が挙げられる。上記非イオン界面活性剤お よび両性界面活性剤の感光性組成物中に占める割合は、 0.05~15重量%が好ましく、より好ましくは0.1~ 5重量%である。本発明における感光性組成物中には、 露光後直ちに可視像を得るための焼き出し剤や、画像着 色剤としての染料や顔料を加えることができる。焼き出 し剤としては、露光によって酸を放出する化合物(光酸 放出剤) と塩を形成し得る有機染料の組合せを代表とし て挙げることができる。具体的には、特開昭50-36209 号、同53-8128号の各公報に記載されているローナフト キノンジアジドー4-スルホン酸ハロゲニドと塩形成性 有機染料の組合せや、特開昭53-36223 号、同54-7472 8 号、同60-3626号、同61-143748号、同61-151644号 および同63-58440 号の各公報に記載されているトリハ ロメチル化合物と塩形成性有機染料の組合せを挙げるこ とができる。かかるトリハロメチル化合物としては、オ キサゾール系化合物とトリアジン系化合物とがあり、ど ちらも経時安定性に優れ、明瞭な焼き出し画像を与え る。

【0026】 画像の着色剤としては、前述の塩形成性有機染料以外に他の染料を用いることができる。塩形成性 は特開昭62-170950号公報に配す機染料を含めて、好適な染料として油溶性染料と塩基 操系界面活性剤を添加することに性染料をあげることができる。具体的にはオイルイエロ 量は、全感光性組成物の0.01~-#101、オイルイエロー#103、オイルピンク# 50 くは0.05~0.5 重量%である。

24

312、オイルグリーンBG、オイルブルーBOS、オ イルブルー#603、オイルブラックBY、オイルブラ ックBS、オイルプラックT-5.05 (以上オリエント 化学工業(株)製)、ピクトリアピュアプルー、クリス タルパイオレット (CI42555)、メチルパイオレ ット (СІ42535)、エチルパイオレット、ローダ ミンB (CI145170B)、マラカイトグリーン (CI42000)、メチレンプルー(CI5201 5) などを挙げることができる。また、特開昭62-2932 47号公報に記載されている染料は特に好ましい。これら の染料は、感光性組成物全固形分に対し、0.01~10 重量%、好ましくは0.1~3重量%の割合で感光性組成 物中に添加することができる。更に本発明の感光性組成 物中には必要に応じ、強膜の柔軟性等を付与するために 可塑剤が加えられる。例えば、プチルフタリル、ポリエ チレングリコール、クエン酸トリプチル、フタル酸ジエ チル、フタル酸ジプチル、フタル酸ジヘキシル、フタル 酸ジオクチル、リン酸トリクレジル、リン酸トリプチ ル、リン酸トリオクチル、オレイン酸テトラヒドロフル フリル、アクリル酸またはメタアクリル酸のオリゴマー およびポリマー等が用いられる。

【0027】本発明のポジ型感光性平版印刷版は、通常 上記各成分を溶媒に溶かして、適当な支持体上に塗布す ることにより製造することができる。ここで使用する溶・ 媒としては、エチレンジクロライド、シクロヘキサノ ン、メチルエチルケトン、メタノール、エタノール、ブ ロパノール、エチレングリコールモノメチルエーテル、 2-メトキシエチルアセテート、1-メトキシ-2-プ ロピルアセテート、ジメトキシエタン、乳酸メチル、乳 酸エチル、N, N-ジメトキシアセトアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、テトラメチルウレア、N-メチ ルピロリドン、ジメチルスルホキシド、スルホラン、ア ブチルラクトン、トルエン等をあげることができるが。 これに限定されるものではない。これらの溶媒は単独あ るいは混合して使用される。溶媒中の上記成分(添加剤 を含む全固形分)の濃度は、好ましくは1~50重量% である。また強布、乾燥後に得られる支持体上の塗布量 (固形分) は、用途によって異なるが、感光性印刷版に ついていえば一般的に0.5~5.0g/m²が好ましい。塗 布する方法としては、種々の方法を用いることができる が、例えば、パーコーター塗布、回転塗布、スプレー塗 布、カーテン塗布、ディップ塗布、エアーナイフ塗布、 ブレード強布、ロール強布等を挙げることができる。強 布量が少なくなるにつれて、見かけの感度は大になる が、感光膜の皮膜特性は低下する。本発明における感光 性層中には、塗布性を良化するための界面活性剤、例え ば特開昭62-170950号公報に記載されているようなフッ 素系界面活性剤を添加することができる。 好ましい添加 量は、全感光性組成物の0.01~1重量%さらに好まし

【0028】本発明に使用される支持体としては、寸度 的に安定な板状物であり、例えば、紙、プラスチック (例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレ ン等)がラミネートされた紙、金属板(例えば、アルミ ニウム、亜鉛、銅等)、プラスチックフィルム (例え ば、二酢酸セルロース、三酢酸セルロース、プロピオン 酸セルロース、酪酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、 硝酸セルロース、ポリエチレンテレフタレート、ポリエ チレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリカーポネ ート、ポリピニルアセタール等)、上記のごとき金属が 10 ラミネート、もしくは蒸着された紙、もしくはプラスチ ックフィルム等が含まれる。その中でも寸法安定性がよ く、比較的安価であるアルミニウム板は特に好ましい。 好適なアルミニウム板は、純アルミニウム板およびアル ミニウムを主成分とし、微量の異元素を含む合金板であ り、更にアルミニウムがラミネートもしくは蒸着された プラスチックフィルムでもよい。アルミニウム合金に含 まれる異元素には、ケイ素、鉄、マンガン、銅、マグネ シウム、クロム、亜鉛、ピスマス、ニッケル、チタンな どがある。合金中の異元素の含有量は高々10重量%以 20 下である。本発明において特に好適なアルミニウムは、 純アルミニウムであるが、完全に純粋なアルミニウムは 精錬技術上製造が困難であるので、僅かに異元素を含有 するものでもよい。このように本発明に適用されるアル ミニウム板は、その組成が特定されるものではなく、従 来より公知公用の素材のアルミニウム板を適宜に利用す ることができる。本発明で用いられるアルミニウム板の

【0029】アルミニウム板を粗面化するに先立ち、所 望により、表面の圧延油を除去するための例えば界面活 性剤、有機溶剤またはアルカリ性水溶液などによる脱脂 処理が行われる。アルミニウム板の表面の粗面化処理 は、種々の方法により行われるが、例えば、機械的に粗 面化する方法、電気化学的に表面を溶解粗面化する方法 および化学的に表面を選択溶解させる方法により行われ る。機械的方法としては、ボール研磨法、ブラシ研磨 法、プラスト研磨法、バフ研磨法などの公知の方法を用 いることができる。また、電気化学的な粗面化法として は塩酸または硝酸電解液中で交流または直流により行う 方法がある。また、特開昭54-63902 号に開示されてい るように両者を組み合わせた方法も利用することができ る。この様に粗面化されたアルミニウム板は、必要に応 じてアルカリエッチング処理および中和処理された後、 所望により表面の保水性や耐摩耗性を高めるために陽板 酸化処理が施される。アルミニウム板の陽極酸化処理に 用いられる電解質としては、多孔質酸化皮膜を形成する 種々の電解質の使用が可能で、一般的には硫酸、リン 酸、蓚酸、クロム酸あるいはそれらの混酸が用いられ る。それらの電解質の濃度は電解質の種類によって適宜 決められる。

厚みはおよそ0.1 ㎜~0.6 ㎜程度である。

26

【0030】陽極酸化の処理条件は用いる電解質により 種々変わるので一概に特定し得ないが一般的には電解質 の濃度が1~80重量%溶液、液温は5~70℃、電流 密度5~60A/dm²、電圧1~100V、電解時間1 0秒~5分の範囲であれば適当である。陽極酸化皮膜の 量は1.0g/ш²より少ないと耐刷性が不十分であった り、平版印刷版の非画像部に傷が付き易くなって、印刷 時に傷の部分にインキが付着するいわゆる「傷汚れ」が 生じ易くなる。陽極酸化処理を施された後、アルミニウ ム表面は必要により親水化処理が施される。本発明に使 用される親水化処理としては、米国特許第2.714.066 号、同第3,181,461 号、第3,280,734 号および第3,902. 734 号に開示されているようなアルカリ金属シリケート (例えばケイ酸ナトリウム水溶液) 法がある。この方法 においては、支持体がケイ酸ナトリウム水溶液で浸清机 理されるかまたは電解処理される。他に特公昭36-2206 3 号公報に開示されているフッ化ジルコン酸カリウムお よび米国特許第3,276,868 号、同第4,153,461 号、同第 4,689,272 号に開示されているようなポリビニルホスホ ン酸で処理する方法などが用いられる。

【0031】本発明のポジ型感光性平版印刷版は、支持 体上にポジ型の感光性組成物を設けたものであるが、必 要に応じてその間に下塗層を、感光性組成物層の上にマ ット層を設けることができる。下塗層成分としては種々 の有機化合物が用いられ、例えば、カルポキシメチルセ ルロース、デキストリン、アラビアガム、2-アミノエ チルホスホン酸などのアミノ基を有するホスホン酸類、 置換基を有してもよいフェニルホスホン酸、ナフチルホ スホン酸、アルキルホスホン酸、グリセロホスホン酸、 メチレンジホスホン酸およびエチレンジホスホン酸など の有機ホスホン酸、置換基を有してもよいフェニルリン 酸、ナフチルリン酸、アルキルリン酸およびグリセロリ ン酸などの有機リン酸、置換基を有してもよいフェニル ホスフィン酸、ナフチルホスフィン酸、アルキルホスフ イン酸およびグリセロホスフィン酸などの有機ホスフィ ン酸、グリシンやβ-アラニンなどのアミノ酸類、およ びトリエタノールアミンの塩酸塩などのヒドロキシ基を 有するアミンの塩酸塩等から選ばれるが、2種以上混合 して用いてもよい。

40 【0032】この有機下塗層は次のような方法で設けることができる。即ち、水またはメタノール、エタノール、メチルエチルケトンなどの有機溶剤もしくはそれらの混合溶剤に上記の有機化合物を溶解させた溶液をアルミニウム板上に塗布、乾燥して設ける方法と、水またはメタノール、エタノール、メチルエチルケトンなどの有機溶剤もしくはそれらの混合溶剤に上記の有機化合物を溶解させた溶液に、アルミニウム板を浸漬して上記化合物を吸着させ、その後水などによって洗浄、乾燥して有機下塗層を設ける方法である。前者の方法では、上記の有機化合物の0.005~10重量%の濃度の溶液を種々

の方法で墜布できる。また後者の方法では、溶液の濃度 は0.01~20重量%、好ましくは0.05~5重量%で あり、浸漬温度は20~90℃、好ましくは25~50 でであり、浸漬時間は0.1秒~20分、好ましくは2秒 ~1分である。これに用いる溶液は、アンモニア、トリ エチルアミン、水酸化カリウムなどの塩基性物質や、塩 酸、リン酸などの酸性物質によりpH1~12の範囲に調 整することもできる。また、感光性平版印刷版の調子再 現性改良のために黄色染料を添加することもできる。有 機下塗層の被覆量は、2~200g/㎡が適当であり、 好ましくは5~100㎏/㎡である。上記の被覆量が2 mg/m²よりも少ないと十分な耐刷性能が得られない。ま た、200mg/m²より大きくても同様である。

【0033】また、本発明のポジ型感光性組成物層の表 面には、真空焼き枠を用いた密着露光の際の真空引きの 時間を短縮し、且つ焼きポケを防ぐため、マット層が設 けられる。具体的には特開昭50-125805号、特公昭57-6582号、同61-28986 号の各公報に記載されているよう なマット層を設ける方法、特公昭62-62337 号公報に配 載されているような固体粉末を熱融着させる方法などが 挙げられる。本発明に用いられるマット層の平均径は1 00 μm以下が好ましく、より好ましい範囲としては2 ~8 μmである。平均径が大きくなると、細線が付き難 く、ハイライトドットも点減りし、調子再現上好ましく ない。平均径が2μm以下では真空密着性が不十分で焼 きポケを生じる。マット層の塗布量は5~200mg/m² が好ましく、更に好ましくは20~150mg/m2であ る。強布量がこの範囲より大きいと擦傷の原因となり、 これよりも小さいと真空密着性が不十分となる。上記の 様にして作成されたポジ型感光性平版印刷版は、通常、 像露光、現像処理を施される。像露光に用いられる活性 光線の光源としては、例えば、水銀灯、メタルハライド **ランプ、キセノンランプ、ケミカルランプ、カーボンア** ーク灯等がある。放射線としては、電子線、X線、イオ ンピーム、遠赤外線などがある。またg線、i線、Deep - UV光、高密度エネルギーピーム (レーザーピーム) も使用される。レーザーピームとしてはヘリウム・ネオ ンレーザー、アルゴンレーザー、クリプトンレーザー、 ヘリウム・カドミウムレーザー、KrFエキシマレーザ 一等が挙げられる。

【0034】本発明のポジ型感光性平版印刷版の現像液 および補充液としては従来より知られているアルカリ水 溶液が使用できる。例えば、ケイ酸ナトリウム、同カリ ウム、第3リン酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニ ウム、第2リン酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニ ウム、炭酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、 炭酸水素ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、ほ う酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、水酸化 ナトリウム、同アンモニウム、同カリウムおよび同リチ ウムなどの無機アルカリ塩が挙げられる。また、モノメ 50 明の感光性平版印刷版を画像露光し、現像し、水洗及び

チルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、モノ エチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、モ ノイソプロピルアミン、ジイソプロピルアミン、トリイ ソプロピルアミン、n-プチルアミン、モノエタノール アミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、 モノイソプロパノールアミン、ジイソプロパノールアミ ン、エチレンイミン、エチレンジアミン、ピリジンなど の有機アルカリ剤も用いられる。これらのアルカリ剤は 単独もしくは2種以上を組み合わせて用いられる。これ らのアルカリ剤の中で特に好ましい現像液は、ケイ酸ナ トリウム、ケイ酸カリウム等のケイ酸塩水溶液である。 その理由はケイ酸塩の成分である酸化珪素SiO2 とアル

カリ金属酸化物 M20の比率と濃度によって現像性の關節

が可能となるためであり、例えば、特開昭54-62004 号

公報、特公昭57-7427号に記載されているようなアルカ

リ金属ケイ酸塩が有効に用いられる。

28

【0035】更に自動現像機を用いて現像する場合に は、現像液よりもアルカリ強度の高い水溶液(補充液) を現像液に加えることによって、長時間現像タンク中の 現像液を交換する事なく、多量のPS版を処理できるこ とが知られている。本発明においてもこの補充方式が好 ましく適用される。本発明に使用される現像液および補 充液には現像性の促進や抑制、現像力スの分散および印 刷版画像部の親インキ性を高める目的で必要に応じて種・ 々の界面活性剤や有機溶剤を添加できる。好ましい界面・ 活性剤としては、アニオン系、カチオン系、ノニオン系。 および両性界面活性剤があげられる。更に本発明に使用 される現像液および補充液には必要に応じて、ハイドロ キノン、レゾルシン、亜硫酸、亜硫酸水素酸などの無機 酸のナトリウム塩、カリウム塩等の還元剤、更に有機力 ルボン酸、消泡剤、硬水軟化剤を加えることもできる。 上記現像液および補充液を用いて現像処理された印刷版 は水洗水、界面活性剤等を含有するリンス液、アラピア ガムや澱粉誘導体を含む不感脂化液で後処理される。本 発明の印刷版の後処理にはこれらの処理を種々組合せて 用いることができる。

【0036】近年、製版・印刷業界では製版作業の合理 化および標準化のため、印刷版用の自動現像機が広く用 いられている。この自動現像機は、一般に現像部と後処 理部からなり、印刷版を搬送する装置と各処理液槽およ びスプレー装置からなり、露光済みの印刷版を水平に搬 送しながら、ポンプで汲み上げた各処理液をスプレーノ ズルから吹き付けて現像処理するものである。また、最 近は処理液が満たされた処理液槽中に液中ガイドロール などによって印刷版を浸漬搬送させて処理する方法も知 られている。このような自動処理においては、各処理液 に処理量や稼働時間等に応じて補充液を補充しながら処 理することができる。また、実質的に未使用の処理液で 処理するいわゆる使い捨て処理方式も適用できる。本発

わかった。

/又はリンス及び/又はガム引きして得られた平版印刷版に不必要な画像部(例えば原画フィルムのフィルムエッジ跡など)がある場合には、その不必要な画像部の消去が行なわれる。このような消去は、例えば特公平 2-13293 号公報に記載されているような消去液を不必要画像部に塗布し、そのまま所定の時間放置したのちに水洗することにより行なう方法が好ましいが、特別平59-174842号公報に記載されているようなオプティカルファイパーで導かれた活性光線を不必要画像部に照射したのち現像する方法も利用できる。

【0037】以上のようにして得られた平版印刷版は所 望により不感脂化ガムを塗布したのち、印刷工程に供す ることができるが、より一層の高耐刷力の平版印刷版と したい場合にはバーニング処理が施される。平版印刷版 をパーニングする場合には、パーニング前に特公昭61-2518号、同55-28062 号、特開昭62-31859 号、同61-159655号の各公報に記載されているような整面液で処理 することが好ましい。その方法としては、該整面液を浸 み込ませたスポンジや脱脂綿にて、平版印刷版上に塗布 するか、整面液を満たしたパット中に印刷版を浸漬して 20 **塗布する方法や、自動コーターによる塗布などが適用さ** れる。また、塗布した後でスキージ、あるいは、スキー ジローラーで、その塗布量を均一にすることは、より好 ましい結果を与える。整面液の塗布量は一般に0.03~ 0.8 g/m² (乾燥重量) が適当である。整面液が塗布さ れた平版印刷版は必要であれば乾燥された後、バーニン グプロセッサー(たとえば富士写真フイルム(株)より 販売されているパーニングプロセッサー: BP-130 0) などで高温に加熱される。この場合の加熱温度及び 時間は、画像を形成している成分の種類にもよるが、1 30 80~300℃の範囲で1~20分の範囲が好ましい。 パーニング処理された平版印刷版は、必要に応じて適 宜、水洗、ガム引きなどの従来より行なわれている処理 を施こすことができるが水溶性高分子化合物等を含有す る整面液が使用された場合にはガム引きなどのいわゆる 不感脂化処理を省略することができる。この様な処理に よって得られた平版印刷版はオフセット印刷機等にかけ られ、多数枚の印刷に用いられる。

[0038]

【実施例】以下、実施例により、本発明を詳細に説明す 40 るが、本発明はこれらに限定されるものではない。

(合成例1) (化合物(X) の合成)

 $1-[\alpha-メチル-\alpha-(4-ヒドロキシフェニル) エチル] -4-[\alpha, \alpha-ピス(4-ヒドロキシフェニル) エチル] ベンゼン42.4g <math>(0.10\,\mathrm{mol})$ 、水酸化カリウム $19.6\,\mathrm{g}$ $(0.35\,\mathrm{mol})$ 及び水 $250\,\mathrm{ml}\,\mathrm{e}1$ 1 ナス型フラスコに入れ、さらにホルマリン水溶液 (37%) $120\,\mathrm{ml}$ $(1.5\,\mathrm{mol})$ を加え、 $50\,\mathrm{C}$ で 8 時間攪拌した。

感光液(単位はグラム)

反応終了後、濃塩酸 33.3 ml (0.4 mol)、米水1250 ml中に注ぎ、白色粉末を析出させた。この白色粉末をろ過、水洗後、再結晶(メタノール/メチルエチルケトン = 1/1)することにより、1- [α-メチルーα-(4-ヒドロキシフェニル)エチル]-4- [α, α-ピス(4-ヒドロキシフェニル)エチル]ペンゼンのヘキサメチロール化物(一般式(3)においてY¹~Y⁶がすべてメチロール基である化合物)54.8 gを得た。得られた化合物は、液体クロマトグラフィーより純度99.2%、NMRより、ヘキサメチロール化物であることが

30

【0039】(合成例2) (化合物(XI)の合成)

α, α΄, α″ートリス (4ーヒドロキシフェニル)ー
1, 3, 5ートリイソプロピルペンゼン48.1g (0.1 0 mol)、水酸化ナトリウム16.0g (0.40 mol)及び水300 mlを11ナス型フラスコに入れ、さらにホルマリン水溶液 (37%)145 ml (1.8 mol)を加え、室温で12時間攪拌した。反応終了後、濃塩酸40 ml (0.48 mol)、氷水1500 ml中に注ぎ、白色粉末を析出させた。この白色粉末をろ過、水洗後、再結晶(メタノール/メチルエチルケトン=2/3)することにより、α,α′,α″ートリス (4ーヒドロキシフェニル)ー1,3,5ートリイソプロピルペンゼンのメチロール化物(一般式 (XI) の化合物)60.5gを得た。得られた化合物はNMRより、一般式 (XI) のY中のメチロール基の割合は95%であることがわかった。

【0040】(実施例1~8) 厚み0.3ミリのアルミニウム板(材質1050)をトリクロロエチレン洗浄して脱脂した後、ナイロンプラシと400メッシュのバミスー水懸濁液を用いこの表面を砂目立てし、よく水で洗浄した。この板を45℃の25米水酸化ナトリウム水溶液に9秒間浸漬してエッチングを行い水洗後、更に20%硝酸に20秒間浸漬して水洗した。この時の砂目立て表面のエッチング量は約3g/m²であった。次にこの板を7%硫酸を電解液として電流密度15A/dm²で3g/m²の直流陽極酸化皮膜を設けた後、水洗乾燥した。次にこのアルミニウム板に下記下塗り液を塗布し、80℃、30秒間乾燥した、乾燥後の被覆量は10mg/m²であった。

【0041】 (下塗り液)

β-アラニン0.1 gフェニルホスホン酸0.05 gメタノール40 g純水60 g

さらにこのアルミニウム板に下記感光液を塗布し、100℃2分間乾燥をしてポジ型感光性平版印刷版を得た。 乾燥後の塗布量はすべて2.0g/m²であった。

[0042]

ナフトキノン-1, 2-ジアジド-5-スルホン酸

21	

クロリドとピロガロールーアセトン樹脂との エステル化物*1

クレゾールーホルムアルデヒドノポラック (表1に記載のとおり)

(メタ:パラ比=6:4、重量平均分子量1800、

未反応クレゾール0.5%含有)

p-オクチルフェノールーホルムアルデヒド 0.02

ナフトキノン-1、2-ジアジド-4-スルホン 0.01

酸クロリド

(表1に記載のとおり) フェノール誘導体 テトラヒドロ無水フタル酸 0.05

0.02 4-(p-N, N-ジエトキシカルポニルアミノ フェニル) -2, 6-ピス (トリクロロメチル)

-s-トリアジン

4- (p-N- (p-ヒドロキシベンゾイル) 0.02 アミノフェニル) -2, 6-ピス (トリクロロ

メチル) - s - トリアジン

0.03 ピクトリアピュアプル-BOHの対イオンを

1-ナフタレンスルホン酸にした染料

メガファックF-176 (大日本インキ化学工業 0.06

(株) 製、フッ素系界面活性剤) *2

メチルエチルケトン*3 1 2 2-メトキシー1-プロパノール** 15

*1:実施例3はナフトキノン-1,2-ジアジド-5 **4:実施例1は使用せず

- スルホン酸クロリドとピロガロール-アセトン樹脂と [0043]

のエステル化物を使用。

【表1】

*2:実施例1は0.15g、*3:実施例1は25g、 *

-	レゾールーホ	フ:	フェノール誘導体			
	√ムアルデヒド ′ポラックの 使用量(g)	一般式	Y中のCH2OH 基 の割合(%)	使用量(g)		
実施例1	2. 1 0	(X)	100	0.06		
実施例2	2. 1 0 5	(XI)	9 5	0.055		
実施例3	2. 1 0	(IIX)	8 5	0.06		
実施例4	2. 0 0	(XIIIX)	6 5	0.16		
実施例5	2.085	(VIV)	8 0	0.075		
実施例 6	2.06	(XV)	100	0.10		
実施例7	2. 0 4	(XVI)	9 0	0.12		
実施例8	2. 0 8	(IIVX)	9 5	0.08		
比較例1	2. 1 6	_	_	_		
比較例2	2. 1 0	(XXII)		0.06		
比較例3	1.76	(XXII)		0.40		
比較例4	2. 0 6	(XXIII)		0.10		
比較例 5	1.66	(XXIII)		0.50		
比較例 6	2. 0 8	(XXIV)		0.08		
比較例7	1. 7 1	(XXIV)		0.45		

【0044】比較例に用いた化合物 (XXII) 、(XXIII) 50 、(XXIV)は、それぞれ、ペンゼン核を1~3個有する

[0045]

下記構造のものであり、 (XXII) 、(XXIII) は、特公平 1-49932 号の実施例に記載されている化合物である。 【化13】

【0046】これらのポジ型感光性平版印刷版を30ア ンペアのカーポンアーク灯で70cmの距離から露光した 後、DP-4 (商品名:富士写真フィルム株式会社製) の8倍希釈液により、25℃40秒間自動現像(800 U: 富士写真フィルム株式会社製自動現像機による) を 行った。この時の適性露光時間は濃度差0.15のグレー スケール (富士写真フィルム株式会社製) で5段が完全 にクリヤーになる点とし、これにより感光性平版印刷版 の感度とした。またDP-4の8倍希釈液で25℃のバ ット現像にて40秒現像時におけるグレースケールのベ 夕段数から二段変化する時間(以下現像許容性と称 す。) を求めた。これらのポジ型感光性平版印刷版の感 度(露光時間)と現像許容性の結果を表2に示す。次 に、これらの感光性平版印刷版を、真空焼枠中で、ハイ ドライドランプを光源として、透明ペース上で、ポジ原 稿フィルムを通して、60秒間露光し、次いで、富士写 真フィルム株式会社製現像液、DP-4(1:8)、リ ンス液 FR-3 (1:7) を仕込んだ自動現像機を通し

て処理した。次いで富士写真フィルム株式会社製ガムG **U-7 (1:1) で版面を処理し、1日放置後、ハイデ** ルKOR-D機で印刷した。良好な印刷物が得られるま でに要した枚数(着肉性)を表2に示す。

【0047】次にこれらの感光性平版印刷版を、真空焼 枠中で、ハライドランプを光源として、透明ベース上で ポジ原稿フィルムを通して、60秒間露光し、次いで富 士写真フィルム株式会社製現像液、DP-4 (1: 8)、リンス液 FR-3 (1:7) を仕込んだ自動現像 機を通して処理した。さらに富士写真フィルム株式会社 製パーニング整面液BC-3で版面をふき、パーニング 装置BP-1300で7分間処理した。次いで、富士写 真フィルム株式会社製ガムGU-7を水で2倍に希釈し た液で版面を処理し、1日放置後、ハイデルKOR-D 機で印刷した。パーニング温度、得られた印刷枚数、網 画像部の絡みの程度を表2に示す。

[0048]

【表2】

	感度 (露光	現像 許容	着肉 性		-	ペーニン	グ温度		
	時間)(秒)	性 (分)	(枚) ·	1 8	30℃	2 2	20℃	250℃	
				耐刷 力 (万枚)	網画像 部の絡 みの程 度	耐刷 カ (万枚)	網画像 部の絡 みの程 度	耐刷 カ (万枚)	網画像 部の絡 みの程 度
実施例1	45	6	7	25	Α	35	A	45	В
実施例2	45	6	7	20	Α	32	A∼B	40	В
実施例3	40	6	7	25	Α	30	Α	45	В
実施例4	40	6	7	25	Α	33	Α	43	В
実施例 5	35	6	8	22	Α	32	Α	46	В
実施例 6	40	6	7	26	Α	34	A	44	В
実施例7	45	6	7	23	Α	32	Α	42	В
実施例8	45	6	7	25	Α	35	Α	45	В
比較例1	60	7	7	15	C~D	22	D	30	E
比較例2	55	5	9	15	C~D	23	D	32	E
比較例3	50	2	>100	30	D	40	D~E	50	E
比較例4	55	5	9	15	C~D	22	D	33	E
比較例 5	50	2	>100	30	D	42	D~E	50	E
比較例 6	55	5	10	15	C∼D	22	D	33	E
比較例7	50	2.5	100	31	C~D	38	D	50	E

網画像部の絡みの程度

A:全くない、 B:ほとんどない、 C:わずかにあ り、D:あり、 E:激しい

【0049】表2に示した結果より、本発明のフェノー ル誘導体を添加した実施例1~8は、無添加の比較例1 と比べていかなる温度でパーニング処理を行なっも、非 画像部の汚れは、ほとんどなく、耐刷力も向上している ことがわかる。一方、特公平1-49932 号に記載の化合 物を用いた比較例2~5は、非画像部の汚れを良化する 効果は全くみられず、添加量の多い比較例3及び5にお いて、耐刷力向上効果がみられるにすぎない。さらに本 発明のフェノール誘導体を添加した実施例1~8は、比 較例1と比べて感度が上昇(適性露光時間が短い)して 40 に感光性平版印刷版を作成した。 おり、現像許容性は、わずかに劣化するが、実用上問題 ない程度である。一方、特公平1-49932 号に記載の化 合物を用いた比較例2~5は、感度を上昇させる効果は

わずかにあるものの、現像許容性が大幅に低下する。ま た、髙耐刷化を図った特公平1-49932 号公報の比較例 30 3及び5は、着肉性の劣化が激しく、刷り出し時の損紙 が非常に多いことがわかる。以上のことから、本発明の フェノール誘導体は、大幅な現像許容性の低下をおこさ ず、高感度化し、着肉性の劣化も起こさず、しかもいか・・ なる温度においてもパーニング時の非画像部の汚れを大 幅に低減させ、しかも、耐刷力を向上させる非常に優れ たものであることがわかる。

【0050】 (実施例9~16) 実施例1における感光 液中のクレゾールーホルムアルデヒドノポラック2.10 gを表3に示す様に変更した以外、実施例1と全く同様

[0051]

【表3】

実施例1におけるクレゾールーホルムアルデヒドノボラック (メタ: パラ比=6:4) 2.10gに相当する組成物

実施例9 クレゾールーホルムアルデヒドノボラック (メタ:パラ比=6:4、 重量平均分子量3150、未反応クレゾール0.6%含有)2.10g

実施例10 クレゾールーホルムアルデヒドノボラック (メタ:パラ比=6:4、

重量平均分子量1800、未反応クレゾール0.5%含有)1.80g m-クレゾールーホルムアルデヒドノボラック(重量平均分子量 2200) 0.30g

実施例11 クレゾールーホルムアルデヒドノボラック (メタ:バラ比=6:4、 重量平均分子量1800、未反応クレゾール0.5%含有)1.30g フェノール/pークレゾールーホルムアルデヒドノボラック (フェノ ール/クレゾール比=4/6、重量平均分子量1200、未反応クレ ゾール1.2%含有) 0.80g

実施例12 フェノール/クレゾールーホルムアルデヒドノボラック (フェノール /メタ/パラ比=40:36:24、重量平均分子量6200) 2.10g

実施例13 フェノール/クレゾールーホルムアルデヒドノボラック (フェノール /メタ/パラ比=40:36:24、重量平均分子量1500) 2.10g

実施例14 クレゾールーホルムアルデヒドノボラック(メタ:バラ比=6:4、 重量平均分子量1800、未反応クレゾール0.5%含有)1.50g フェノール/pークレゾールーホルムアルデヒドレゾール(フェノー ル/クレゾール比=9/1、重量平均分子量1400、一CH20H 基を もたない) 0.60g

実施例15 クレゾールーホルムアルデヒドノボラック(メタ:パラ比=6:4、 重量平均分子量1800、未反応クレゾール0.5%含有)1.80g N-(p-アミノスルホニルフェニル)アクリルアミド/n-プチル アクリレート/ジエチレングリコールモノメチルエーテルメタクリレ ート(40/40/20)の共重合体 0.30g

実施例16 クレゾールーホルムアルデヒドノボラック (メタ:バラ比=6:4、 重量平均分子量1800、未反応クレゾール0.5%含有)1.85g pーヒドロキシフェニルメタクリルアミド/ベンジルアクリレート/ 2ーヒドロキシエチルメタクリレート (40/30/30) の共重合 体 0.25g

【0052】さらに、実施例9~16において、使用した一般式(X)の化合物を除き、相当する重量のクレゾールーホルムアルデヒドノボラック(メタ:パラ比=6:4、重量平均分子量1800、未反応クレゾール0.5%合有)を添加したもの、すなわち、本発明のフェノ

ール誘導体を含まないものを比較例8~15とした。各 感光性平版印刷版を実施例1と同様にパーニング処理、 印刷を行った。結果を表4に示す。 【0053】

パーニング温度

【表4】

	180℃		220℃		250℃	
	耐刷力 (万枚)	網画像部 の絡みの 程度	耐刷力 (万枚)	網画像部 の絡みの 程度	耐刷力 (万枚)	網画像部 の絡みの 程度
実施例 9	2 5	A	3 5	Α	4 4	A~B
比較例8	16	C∼D	22	D	3 0	E
実施例10	2 5	Α	3 5	Α	4 5	В
比較例9	15	C~D	2 2	D	3 0	E
実施例11	28	Α	4 2	A∼B	5 0	В
比較例10	18	D	2 7	E	3 5	E

<i>39</i>						40	
実施例12	2 5	Α	3 4	A∼B	4 0	В	
比較例11	15	C~D	23	D~E	3 0	E	
実施例13	26	Α	3 6	A∼B	40	В	
比較例12	15	C~D	2 2	D~E	3 0	E	
実施例14	26	A∼B	44	В	5 5	В	
比較例13	18	D	2 7	E	3 5	E	
実施例15	20	Α	26	Α	38	A∼B	
比較例14	18	C~D	24	D	3 0	E	
実施例16	20	Α	28	Α	38	A∼B	
比較例15	18	C~D	24	D	3 0	E	

【0054】表4から本発明のフェノール誘導体を用いた実施例9~16は、無添加の比較例8~15と比べてどのようなパインダーを用いても、いかなる温度においても、パーニング時の非画像部の汚れを大幅に低下させ、しかも耐刷力を向上させる非常に優れたものである

ことがわかる。

【発明の効果】高温でパーニング処理を行ってもパーニング絡みを生じることがなく、現像許容性が広く、着肉性、耐刷性が優れている。

【手続補正書】

. .

【提出日】平成4年10月28日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体上に感光層を設けてなるポジ型感 光性平版印刷版において、該感光層が、フェノール誘導* - CH2 OR1

(式中、R¹ は水素原子、アルキル基又はアシル基を示す)

【請求項2】 該ポジ型感光性組成物は、ベンゼン核が 1~3個でフェノール性ヒドロキシル基と式(I)で表 わされる基を有する化合物を実質的に含有しないことを 特徴とする請求項1記載のポジ型感光性平版印刷版。

【請求項3】 請求項1に記載のポジ型感光性平版印刷版を、順に、画像露光し、現像し、バーニング処理する

ことかわかる。

*体、水不溶かつアルカリ水可溶性樹脂及び、oーキノンジアジド又はジアゾニウム塩又は露光の際に酸を発生する化合物と酸によって分解可能な少なくとも1個のCーOーC基を有する化合物の混合物を含有するポジ型感光性組成物であって、該フェノール誘導体が、4~8個のベンゼン核、少なくとも1個のフェノール性ヒドロキシル基及び少なくとも2個の式(I)で表わされる基を有することを特徴とするポジ型感光性平版印刷版。

(I)

ことを特徴とする平版印刷版の作製方法。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0042

【補正方法】変更

【補正内容】

[0042]

感光液(単位はグラム)

ナフトキノン-1, 2-ジアジド-5-スルホン酸

0.90

クロリドとピロガロールーアセトン樹脂との

エステル化物*1

クレゾールーホルムアルデヒドノボラック

(表1に記載のとおり)

(メタ:パラ比=6:4、重量平均分子量1800、

未反応クレゾール0.5%含有)

pーオクチルフェノールーホルムアルデヒド

0.02

ナフトキノン-1, 2-ジアジド-4-スルホン

0. 01

酸クロリド

ノポラック

フェノール誘導体

(表1に記載のとおり)

テトラヒドロ無水フタル酸

0.05

4 - (p - N,N - ジエトキシカルポニルアミノ		0.02
フェニル)-2,6-ピス(トリクロロメチル)		
- s -トリアジン		
4 - (p - N - (p - ヒドロキシベンゾイル)		0.02
アミノフェニル)-2,6-ピス(トリクロロ		
メチル)-s-トリアジン		
ピクトリアピュアプル-BOHの対イオンを		0.03
1-ナフタレンスルホン酸にした染料		
メガファックF-176(大日本インキ化学工業		0.06
(株) 製、フッ素系界面活性剤) * 2		
メチルエチルケトン* 3	1 2	
2-メトキシー1-プロパノール* 4	15	

1: 実施例3はナフトキノン-1, 2-ジアジド-<u>4</u> -スルホン酸クロリドとピロガロールーアセトン樹脂と のエステル化物を使用。

*2:実施例1は0.15g、*3:実施例1は25g、

*4:実施例1は使用せず